12,17 Автоэлектронная эмиссия из одностенных углеродных нанотрубок с нанесенными на них атомами цезия

© А.Л. Мусатов¹, К.Р. Израэльянц¹, Е.Г. Чиркова¹, А.В. Крестинин²

 ¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
² Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

E-mail: almus@mail.cplire.ru

(Поступила в Редакцию в окончательном виде 29 декабря 2010 г.)

Обнаружено, что нанесение атомов цезия на слои с одностенными углеродными нанотрубками, предварительно покрытые атомами калия, не только резко увеличивает эмиссионный ток, но и существенно меняет форму вольт-амперной характеристики автоэлектронной эмиссии — характеристика становится нелинейной в координатах Фаулера–Нордгейма. Предполагается, что этот эффект связан с тем, что в данных слоях автоэлектронная эмиссия происходит из одностепенных углеродных нанотрубок, которые после обработки их калием имеют полупроводниковую проводимость *p*-типа, а нанесение цезия приводит к образованию p-n-переходов вблизи кончиков нанотрубок. Часть приложенного напряжения падает на p-n-переходе, что приводит к нелинейности вольт-амперной характеристики.

Нанесение щелочных металлов на одностенные углеродные нанотрубки (ОСНТ) вызывает существенное изменение их характеристик. Ли с соавторами [1] сообщили об увеличении проводимости ОСНТ в 40 раз после нанесения калия. Позднее Сузуки в соавторами [2] обнаружили интеркаляцию атомов Cs и K в пучки ОСНТ. Интеркаляция происходила между индивидуальными нанотрубками внутри пучка. Ряд авторов [3–5] показал, что нанесение атомов Cs на ОСНТ приводит к уменьшению работы выхода нанотрубок и увеличению тока автоэлектронной эмиссии. В настоящей работе в ходе исследований автоэлектронной эмиссии из слоев с ОСНТ после нанесения на них атомов Cs мы обнаружили, что нанесение Cs на ОСНТ, предварительно обработанные атомами калия, не только резко увеличивает эмиссионный ток, но и существенно меняет форму вольт-амперной характеристики автоэлектронной эмиссии — вольт-амперная характеристика в координатах Фаулера-Нордгейма становится резко нелинейной. Ранее, в 60-х годах прошлого века, вольт-амперные характеристики автоэлектронной эмиссии такого типа наблюдались на полупроводниковых эмиттерах на основе Si и Ge p-типа и связывались с образованием *p*-*n*-перехода вблизи кончика эмиттера [6-8]. Мы полагаем, что для наших образцов с нелинейной вольт-амперной характеристикой эмиттирующие ОСНТ после обработки их атомами калия имеют полупроводниковую проводимость *p*-типа, а в результате нанесения Cs вблизи кончика нанотрубки образуется *p*-*n*-переход. При этом часть приложенного напряжения падает на *p*-*n*-переходе, что приводит к нелинейности вольт-амперной характеристики.

Исследуемые ОСНТ были изготовлены в обычном дуговом процессе в гелиевой атмосфере с Ni/Y катализатором. После синтеза материала с ОСНТ проводилась его очистка. Очищенный материал содержал 50–70% ОСНТ. На рис. 1 представлена микрофотография слоя ОСНТ, полученного осаждением на фильтр из раствора очищенных ОСНТ. Микрофотография получена в растровом электронном микроскопе. На рисунке видны пучки нанотрубок различного диаметра. Слои ОСНТ приклеивались к кремниевой пластинке с помощью эпоксидной смолы. Таким образом были получены планарные слои с ОСНТ на кремниевых подложках размером $\approx 1 \times 1$ ст [9].

Исследования автоэлектронной эмиссии из таких слоев проводились в сверхвысоковакуумной установке в вакууме $p \sim 10^{-9}$ Тогг. При исследованиях использовался сферический анод из нержавеющей стали диаметром 2 mm, расположенный на расстоянии 200–400 μ m от поверхности образца. Образец закреплялся на уни-



── 100 nm

Рис. 1. Микрофотография слоя ОСНТ, полученного осаждением на фильтр из раствора очищенных ОСНТ. Микрофотография получена в растровом электронном микроскопе.

версальном манипуляторе. При таких исследованиях расстояние анод-образец определялось по лимбу манипулятора при измерениях эмиссии по отношению к лимбу манипулятора, при котором возникал электрический контакт между анодом и образцом, т.е. когда анод касался поверхности образца. Измерения вольт-амперных характеристик автоэлектронной эмиссии проводились с использованием источника высокого напряжения Keithley 248, пикоамперметра Keithley 6485 и персонального компьютера (ПК) с адаптером интерфейса IEEE-488 (GPIB) с программным обеспечением. С помощью ПК и соответствующей прикладной программы на базе программного пакета Test Point фирмы CEC велось управление экспериментом по измерению вольт-амперных характеристик, а также сбор и запись полученных экспериментальных данных.

Нанесение Cs и K на ОСНТ проводилось в сверхвысоком вакууме непосредственно перед измерениями вольт-амперных характеристик автоэлектронной эмиссии. Источники Cs и K находились перед образцом на расстоянии в несколько сантиметров. В качестве источника Cs использовался источник на основе хромата цезия, нагреваемый электрическим током. При нагреве источника хромат цезия разлагался с выделением свободных атомов Cs, которые испарялись и осаждались на образец с ОСНТ. Такие источники применялись при изготовлении фотокатодов с отрицательным электронным сродством на основе GaAs и других полупроводников [10]. В рабочем режиме поток атомов Cs из источника был такой, что моноатомный слой атомов Cs образуется на поверхности образца за несколько минут в случае, если коэффициент прилипания атомов Cs к поверхности образца близок к единице. В качестве источника К использовался источник такого же типа на основе хромата калия. При нагревании источника выделялись атомы калия, которые испарялись и попадали на поверхность образца с ОСНТ.

В рамках настоящей работы были проведены две серии экспериментов по исследованию влияния атомов цезия на эмиссионные характеристики слоев с ОСНТ. В первой серии эксперименты начинались с очистки кончиков ОСНТ прогревом эмиссионным током 200-300 µA в течение 10-20 min. При использованной форме анода эмитирующая площадь образца была $\sim 10^{-3}\,\mathrm{cm}^2$ и плотность тока составляла несколько десятых A/cm². После этого на очищенные ОСНТ наносились атомы Cs. На рис. 2 представлены вольтамперные характеристики автоэлектронной эмиссии для одного из образцов, измеренные в ходе первой серии экспериментов. Вольт-амперные характеристики анализировались на основе теории Фаулера-Нордгейма [11]. Согласно этой теории, плотность тока автоэлектронной эмиссии ј связана с локальным электрическим полем Е вблизи поверхности эмиттера следующим выражением:

$$j \approx \frac{1.56 \cdot 10^{-6} \cdot E^2}{\varphi} \exp\left(-\frac{6.83 \cdot 10^7 \cdot \varphi^{3/2}}{E}\right).$$
 (1)



Рис. 2. Вольт-амперные характеристики автоэлектронной эмиссии из слоя с ОСНТ после очистки кончиков ОСНТ эмиссионным током (1) и после нанесения атомов Cs на очищенные ОСНТ (2). Работа выхода $\varphi_1 = 4.7 \text{ eV}$ (1) и $\varphi_2(\text{Cs}) = 3 \text{ eV}$ (2). Данные приведены в координатах $\lg I = f(E_{\text{av}})$ (*a*), а также в координатах Фаулера–Нордгейма (*b*).

Здесь *j* выражена в A/cm², E — в V/cm, а работа выхода φ — в eV. Из формулы (1) следует, что в координатах Фаулера–Нордгейма $\ln j/E^2 = f(1/E)$ вольт-амперная характеристика автоэлектронной эмиссии должна укладываться на прямую линию. На рис. 2 характеристики приведены в координатах $\lg I = f(E_{av})$ (рис. 2, *a*) и в координатах Фаулера–Нордгейма $\lg I/E_{av}^2 = f(1/E_{av})$ (рис. 2, *b*). Здесь E_{av} — среднее электрическое поле в промежутке анод–эмиттер, $E_{av} = V/d$, где V — приложенное напряжение, а *d* — расстояние анод–эмиттер. Характеристика *I* соответствует эмиссии из ОСНТ, очищенных прогревом эмиссионным током, а характеристика *2* измерена после нанесения атомов Cs на очищенные ОСНТ.

Как видно из рисунка, характеристики для данного образца являются прямолинейными в координатах Фаулера–Нордгейма, т.е. соответствуют этой теории, развитой для эмиссии из проводников. Прямолинейность характеристик сохраняется после нанесения Cs на OCHT. Анализируя характеристики на основе теории Фаулера–Нордгейма, мы определили для очищенного образца величину коэффициента усиления электрического поля $\beta = E/E_{av}$, где E — локальное электрическое поле вблизи кончика нанотрубок. Полагая, что для OCHT работа выхода $\varphi_1 = 4.7 \,\text{eV}$, как у графита, мы получили, что $\beta = 2800$.

Нанесение Cs резко увеличивает эмиссионный ток и сдвигает вольт-амперную характеристику в сторону меньших средних электрических полей. Величина β определяется структурой слоя с ОСНТ. Поэтому нанесение атомов Cs на ОСНТ не меняет величину β , но уменьшает их работу выхода. Основываясь на теории Фаулера–Нордгейма, мы определили, что характеристике 2 соответствует величина работы выхода, равная $\varphi_2(Cs) = 3 \text{ eV}$. При увеличении времени работы источника Cs работа выхода ОСНТ уменьшается вплоть до $\varphi_3(Cs) = 2.7 \text{ eV}$.

Согласно многочисленным исследованиям адсорбции щелочных металлов на тугоплавких металлах [12], щелочные металлы адсорбируются в виде положительных ионов, и уменьшение работы выхода поверхности $\Delta \phi$ при этом обусловлено скачком потенциала на двойном электрическом слое, образованном заряженными адсорбированными атомами и электронами, сосредоченными в приповерхностной области твердого тела. При малой концентрации адсорбированных атомов (много меньше монослоя) величина $\Delta \phi$ пропорциональна поверхностной концентрации атомов. Вся зависимость $\varphi(n)$ представляет собой кривую с довольно глубоким минимумом, который достигается при субмоноатомном покрытии, а с образованием плотного монослоя изменение работы выхода в основном завершается [12]. Описанная модель основана на том, что потенциал ионизации щелочных металлов меньше, чем работа выхода тугоплавких металлов, и они адсорбируются на поверхность таких металлов в виде положительных ионов. Работа выхода ОСНТ также больше, чем потенциал ионизации щелочных атомов, поэтому следует принять, что эти атомы адсорбируются на ОСНТ в виде положительных ионов. Мы полагаем, что модель снижения работы выхода при адсорбции щелочных металлов, развитая для тугоплавких металлов, справедлива и при нанесении таких металлов на ОСНТ. В соответствии с этой моделью увеличение времени нанесения Cs (в определенных пределах) приводит к уменьшению работы выхода (до 2.7 eV).

Во второй серии эксперименты также начинались с очистки кончиков ОСНТ прогревом эмиссионным током $200-300 \,\mu\text{A}$ в течение $10-20 \,\text{min}$, однако в отличие от первой серии после этого на ОСНТ наносились атомы K, а затем атомы Cs. На рис. 3 представлены вольт-амперные характеристики автоэлектронной эмиссии для одного из образцов с ОСНТ после нанесения атомов K и Cs. Характеристики приведены в координатах $\lg I = f(E_{av})$ (рис. 3, *a*) и в координатах



Рис. 3. Вольт-амперные характеристики автоэлектронной эмиссии из слоя с ОСНТ после очистки кончиков ОСНТ эмиссиооным током (*I*), после нанесения различного количества атомов K на очищенные ОСНТ (*2*, *3*) и после нанесения атомов Cs на ОСНТ, покрытые атомами K (*4*). Для характеристик *I*-*3* работа составляет $\varphi_1 = 4.7 \text{ eV}$, $\varphi_2(K) = 3.95 \text{ eV}$ и $\varphi_3(K) = 4.1 \text{ eV}$ соответственно. Данные приведены в координатах $\lg I = f(E_{\rm av})$ (*a*), а также в координатах Фаулера–Нордгейма (*b*).

Фаулера-Нордгейма (рис. 3, b). Характеристика 1 соответствует эмиссии из ОСНТ, очищенных прогревом эмиссионным током, характеристики 2 и 3 измерены после нанесения различного количества атомов K, а характеристика 4 — после нанесения атомов Cs на ОСНТ, покрытые атомами K. Длительность работы источника K в случае измерения характеристики 3 в 4 раза превышает длительность работы источника K в случае характеристики 2. Это означает, что для характеристики 3 количество атомов K значительно больше.

Как видно из рисунка, нанесение калия приводит к увеличению эмиссионного тока и сдвигу вольт-амперных характеристик в сторону меньшего среднего электрического поля (рис. 3, *a*). При этом характеристики остаются прямолинейными в координатах Фаулера–Нордгейма

(рис. 3, b). Анализируя эти характристики на основе теории Фаулера-Нордгейма и предполагая, что работа выхода очищенных ОСНТ $\phi_1 = 4.7 \, \text{eV}$, мы определили работу выхода ОСНТ, соответствующую характеристикам 2 и 3. Характеристика 2 соответствует минимальной работе выхода ОСНТ, покрытых атомами К. В этом случае $\phi_2(K) = 3.95 \,\text{eV}$. При дальнейшем увеличении числа атомов К на ОСНТ (увеличении времени работы источника К) работа выхода системы ОСНТ-К увеличивается, и для характеристики $3 \ \varphi_3(K) = 4.1 \text{ eV}.$ Такое поведение системы ОСНТ-К соответствует характеристикам, описанным в [12] для случая адсорбции щелочных металлов на W. Для таких систем минимум в зависимости $\varphi(n)$ соответствует субмоноатомному покрытию атомов щелочных металлов, а при дальнейшем увеличении их концентрации ϕ увеличивается.

Наиболее интересный результат, полученный в ходе экспериментов (рис. 3), состоит в том, что нанесение атомов Cs на OCHT, покрытые атомами K, не только резко увеличивает эмиссионный ток и сдвигает вольтамперную характеристику в сторону меньшего E_{av} , но и изменяет форму вольт-амперной характеристки. Характеристика для системы OCHT–K–Cs не соответствует теории Фаулера–Нордгейма: она становится нелинейной в координатах Фаулера–Нордгейма. Причины нелинейности этой характеристики мы обсудим далее.

В ходе дальнейших экспериментов после нанесения атомов К и Сs на ОСНТ кончики ОСНТ вновь очищались прогревом эмиссионным током 200-300 µA в течение 10-20 min и на очищенные ОСНТ наносились атомы Cs. Вольт-амперные характеристики эмиссионного тока после такой обработки ОСНТ приведены на рис. 4 в координатах $\lg I = f(E_{av})$ (рис. 4, *a*) и в координатах Фаулера–Нордгейма (рис. 4, b). Как видно из рис. 4, b, характеристика эмиссионного тока для образца с ОСНТ после нанесения К и Сs и очистки прогревом эмиссионным током (характеристика 1) является прямолинейной в координатах Фаулера-Нордгейма. После нанесения атомов Cs на такие образцы величина эмиссионного тока резко увеличивается, а вольт-амперная характеристика в координатах Фаулера–Нордгейма (характеристика 2) становится существенно нелинейной, причем нелинейность гораздо более резкая, чем для характеристики 4 (рис. 3) при нанесении Cs на ОСНТ с К. В области малых токов $(I < 2 \cdot 10^{-8} \text{ A})$ эмиссионный ток резко увеличивается с ростом E_{av} , однако затем рост тока замедляется, и в координатах Фаулера-Нордгейма наблюдается плато (рис. 4, b). При дальнейшем увеличении E_{av} снова наблюдается рост эмиссионного тока. Таким образом, вольт-амперная характеристика эмиссионного тока для такого слоя с ОСНТ с нанесенными на них атомами Cs состоит из трех областей: область А для малых эмиссионных токов, которая характеризуется быстрым ростом тока с электрическим полем, область В, для которой в координатах Фаулера-Нордгейма наблюдается плато, и область С, в которой вновь происходит быстрый рост тока.



Рис. 4. Вольт-амперные характеристики автоэлектронной эмиссии из слоя с ОСНТ после нанесения атомов К и Сs на очищенные ОСНТ и дополнительной очистки кончиков ОСНТ эмиссионным током (1) и после последующего нанесения атомов Cs на очищенные ОСНТ (2). Данные приведены в координатах lg $I = f(E_{av})$ (a), а также в координатах Фаулера– Нордгейма (b).

Аналогичный вид вольт-амперных характеристик автоэлектронной эмиссии наблюдается в ряде работ в 60-х годах прошлого века при исследовании автоэлектронной эмиссии из полупроводников *p*-типа (Ge, Si) [6-8]. Такие характеристики объяснялись появлением вблизи кончика полупроводникового эмиттера (острия) *p*-*n*перехода за счет проникновения в полупроводник электрического поля и возникновения вблизи поверхности области *n*-типа. На основе гипотезы об образовании *p*-*n*-перехода вид вольт-амперной характеристики объяснялся следующим образом. В области малых токов (область А) имеет место эмиссия из зоны проводимости. В этой области падение напряжения на *p*-*n*-переходе отсутствует. В области B на p-n-переходе падает заметная часть анодного напряжения и рост тока замедляется или практически прекращается (плато). В области С происходит пробой *p*-*n*-перехода и вследствие этого рост концентрации носителей в приповерхностной области, приводящий к росту эмиссионного тока.

Мы полагаем, что нелинейные вольт-амперные характеристики в координатах Фаулера–Нордгейма, полученные во второй серии экспериментов для образцов с ОСНТ с нанесенными атомами К и Сs (характеристика 4 на рис. 3), а также с атомами Cs, нанесенными на систему ОСНТ–К–Сs после ее очистки длительным прогревом эмиссионным током (характеристика 2 на рис. 4), объясняются тем же механизмом эмиссионного тока, что и для случая полупроводниковых эмиттеров *p*-типа (Ge, Si). По-видимому, в этих образцах эмитирующие ОСНТ обладают полупроводниковой проводимостью *p*типа, и на их кончиках после нанесения Cs образуются *p*-*n*-переходы.

Важное отличие эмиттеров на основе ОСНТ от эмиттеров на основе Si и Ge *p*-типа [6-8] состоит в том, что в этих классических полупроводниках *p*-*n*-переход образуется за счет проникновения в полупроводник сильного электрического поля [6-8], а в эмиттерах на основе ОСНТ — за счет нанесения атомов Сs. Без нанесения Cs вольт-амперные характеристики ОСНТ являются прямолинейными в координатах Фаулера-Нордгейма (характеристики 1 на рис. 3, b и рис. 4, b), т.е. p-n-переход не образуется. Образование p-n-перехода при нанесении Cs на ОСНТ, вероятно, связано с тем, что Cs имеет малый потенциал ионизации и адсорбируется на твердое тело с большой работой выхода в виде положительных ионов, отдавая электроны твердому телу [12]. ОСНТ имеют большую работу выхода [5], поэтому Cs адсорбируется на ОСНТ именно таким образом. Нанесение Cs на ОСНТ с полупроводниковой проводимостью р-типа не только уменьшает работу выхода, но также вызывает изгиб энергетических зон вниз. Именно изгиб зон вызывает образование *p*-*n*-перехода вблизи кончиков ОСНТ и приводит к нелинейности вольт-амперной характеристики эмиссионного тока.

Как мы уже отмечали, для образцов, изученных в первой серии экспериментов, после нанесения атомов Cs на ОСНТ вольт-амперная характеристика автоэлектронной эмиссии остается прямолинейной в координатах Фаулера-Нордгейма. Мы полагаем, что это связано с тем, что в данных образцах эмитирующие ОСНТ имеют металлическую проводимость или полупроводниковую проводимость *n*-типа. Нанесение Cs на такие ОСНТ не вызывает образования *p*-*n*-перехода, и характеристики остаются прямолинейными в координатах Фаулера-Нордгейма. Мы предполагаем, что различие типа проводимости образцов с ОСНТ, исследованных в первой и второй сериях экспериментов, связано с влиянием атомов К. В работе [1] сообщалось, что нанесение К на ОСНТ, полученные методом лазерной абляции, резко меняет проводимость. Можно предположить, что нанесение К на ОСНТ, полученные в электрической дуге, меняет не только величину проводимости — возникает проводимость *p*-типа. Прогрев ОСНТ эмиссионным током вызывает сильную интеркаляцию атомов К в пучки ОСНТ и может усиливать эффект трансформации типа проводимости ОСНТ. Кроме того, следует отметить, что материал с ОСНТ, использованный в двух сериях экспериментов, изготавливался в разных дуговых процессах. Поэтому нельзя исключать, что структура ОСНТ в этих образцах различается и это влияет на их проводимость.

Таким образом, в настоящей работе обнаружено, что нанесение атомов Cs на слои с OCHT после нанесения на них атомов K не только резко увеличивает величину эмиссионного тока, но и изменяет форму вольтамперной характеристики. Вольт-амперная характеристика автоэлектронной эмиссии для таких слоев в координатах Фаулера–Нордгейма становится существенно нелинейной. Мы полагаем, что этот эффект объясняется тем, что в данных слоях эмитирующие OCHT обладают полупроводниковой проводимостью *p*-типа, а нанесение Cs приводит к образованию p-*n*-переходов вблизи кончиков OCHT. При протекании большого эмиссионного тока часть приложенного напряжения падает на p-*n*-переходе, что приводит к нелинейности вольтамперной характеристики.

Авторы благодарны А.Б. Ормонту за ценные советы при обсуждении результатов.

Список литературы

- R.S. Lee, H.J. Kim, J.E. Fischer, A. Thess, R.E. Smalley. Nature 388, 255 (1997).
- [2] S. Suzuki, C. Bower, O. Zhou. Chem. Phys. Lett. 285, 230 (1998).
- [3] S. Suzuki, C. Bower, Y. Watanabe, O. Zhou. Appl. Phys. Lett. 76, 4007 (2000).
- [4] A. Wadhawan, R.E. Stallcup II, J.M. Rerez. Appl. Phys. Lett. 78, 108 (2001).
- [5] J. Zhao, J. Han, J.P. Lu. Phys. Rev. B 65, 193 401 (2002).
- [6] J.R. Arthur, Jr. J. Appl. Phys. 36, 3221 (1965).
- [7] P.G. Borzjak, A.F. Yatsenko, L.S. Miroshnichenko. Phys. Status Solidi 14, 403 (1966).
- [8] G.N. Fursey, N.V. Egorov. Phys. Status Solidi 32, 23 (1969).
- [9] A.L. Musatov, A.V. Krestinin, N.A. Kiselev, K.R. Izrael'yants, A.B. Ormont, E.G. Chirkova. Fullerenes Nanotubes Carbon Nanostructures 12, 111 (2004).
- [10] Р.Л. Белл. Эмиттеры с отрицательным электронным сродством / Пер. с англ. М. (1978).
- [11] R.H. Fowler, L. Nordheim. Proc. R. Soc. London A 119, 173 (1928).
- [12] Л.А. Большов, А.П. Напартович, А.Г. Наумовец, А.Г. Федорус. УФН 122, 125 (1977).